清华大学 半导体能带工程 2024 年春季学期

作业2

廖汶锋

2024年3月15日

2.1. 某一维晶格, 晶格常数为 a, 势函数为

$$V(x) = \cos\left(\frac{4\pi x}{a}\right) (eV)$$

利用近自由电子近似模型,计算其第一个和第二个禁带的带隙宽度。

解. 把势函数写成指数形式

$$V(x) = \frac{1}{2} \exp\left(-i\frac{4\pi x}{a}\right) + \frac{1}{2} \exp\left(i\frac{4\pi x}{a}\right) \tag{1-1}$$

所以有 $\overline{V} = V_1 = 0$ 、 $|V_2| = \frac{1}{2} eV$ 。

根据近自由电子模型,第一个和第二个禁带宽度为

$$E_{g,1} = 2|V_1| = 0 \text{eV}$$
 (1-2)

$$E_{g,2} = 2|V_2| = 1 \text{eV}$$
 (1-3)

- 2.2. 设有一晶格常数为 a 的一维晶体, 电子在其中运动;
 - (1) 求布里渊区边界 $2\pi/a$ 处自由电子的能量;
 - (2) 请解释: 布洛赫能带理论相比于索末菲自由电子模型, 主要区别 在前者增加的对什么的考虑; 以及简单说明近自由电子近似的大 致思想;
 - (3) 设周期性势场为

$$V(x) = -V_0 \cos\left(\frac{4\pi x}{a}\right) \cos\left(\frac{2\pi x}{a}\right)$$

其中 $V_0 > 0$,利用近自由电子近似,求布里渊区边界 π/a 、 $2\pi/a$ 、 $3\pi/a$ 处的能隙;

解. (1) 第二布里渊区边界处自由电子能量表达式如下:

$$E_{\frac{2\pi}{a}}^{(0)} = \overline{V} + \frac{\hbar^2}{2m} \left(\frac{2\pi}{a}\right)^2$$
$$= \frac{\hbar^2}{2m} \left(\frac{2\pi}{a}\right)^2 (不妨假设\overline{V} = 0) \tag{2-1}$$

(2) 布洛赫能带理论增加了两个因素,第一个是晶格离子势,即离子 实对电子的势场作用;第二个是电子平均势,即大量电子之间的 平均势场。

近自由电子近似建基于量子力学的微扰论上,以平均势场下的自由电子波函数(行波)作为基态波函数,以晶格的周期性势场作为微扰哈密顿量,求出其余階数的波函数及能量修正项。

(3) 利用积化和差公式化成指数形式

$$V(x) = -\frac{V_0}{4} \left[\exp\left(-i\frac{6\pi x}{a}\right) + \exp\left(-i\frac{2\pi x}{a}\right) + \exp\left(i\frac{2\pi x}{a}\right) + \exp\left(i\frac{6\pi x}{a}\right) \right]$$
 (2-2)

所以布里渊区边界的能隙满足

$$E_{g,\frac{n\pi}{a}} = \frac{V_0}{2} (\delta_{n,-3} + \delta_{n,-1} + \delta_{n,1} + \delta_{n,\pm 3})$$
 (2-3)

因此, 题中所求能隙为

$$E_{g,\frac{\pi}{a}} = E_{g,\frac{3\pi}{a}} = \frac{V_0}{2} \tag{2-4}$$

$$E_{g,\frac{2\pi}{a}} = 0 (2-5)$$